

中国における特許・実用新案の同日出願

アジア特許情報研究会：伊藤徹男

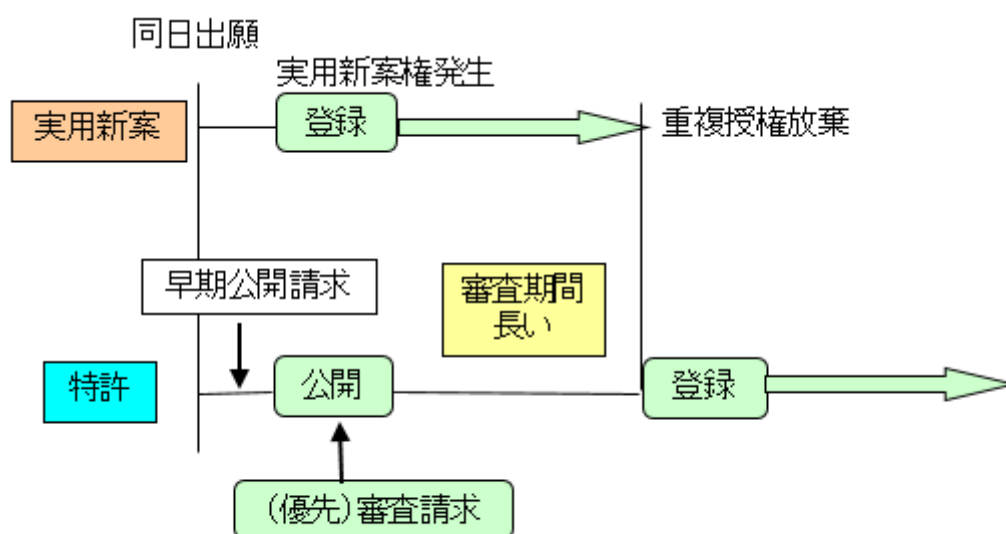
中国の特許と実用新案の二重出願については、2009年の第3次法改正で同じ日（同日）に出願することとされました。それまでは実用新案（または特許）を出願したのち新規性を損なわない範囲内ではほぼ同内容の出願をすればよいとされていました。特許と実用新案の二重出願、特実併願とも言われますが、最近では「特許・実用新案の同日出願」と呼ばれることが多くなりました。

最近では実用新案も実体審査するようになりましたが、特許の場合には審査に時間を要し、権利行使するまでにしばらくかかりますが、実用新案の場合は原則、方式審査ののち登録までの期間が短く権利行使しやすい、とされています。

法制度の詳細は割愛しますが、いくつかのポイントを紹介しておきます。

1つは、同日出願したのち、特許が審査を経て登録になると同時に実用新案権を放棄することになりますが（重複授權放棄）、この時点まで実用新案が生きていることが条件となっています。

特許も審査請求して成立する目途もついたからと言って実用新案が年金未納や放棄などで権利失効している場合には、その特許は同時に出願した実用新案が先願となって失効してしまいます（もちろん同一出願人であっても）。

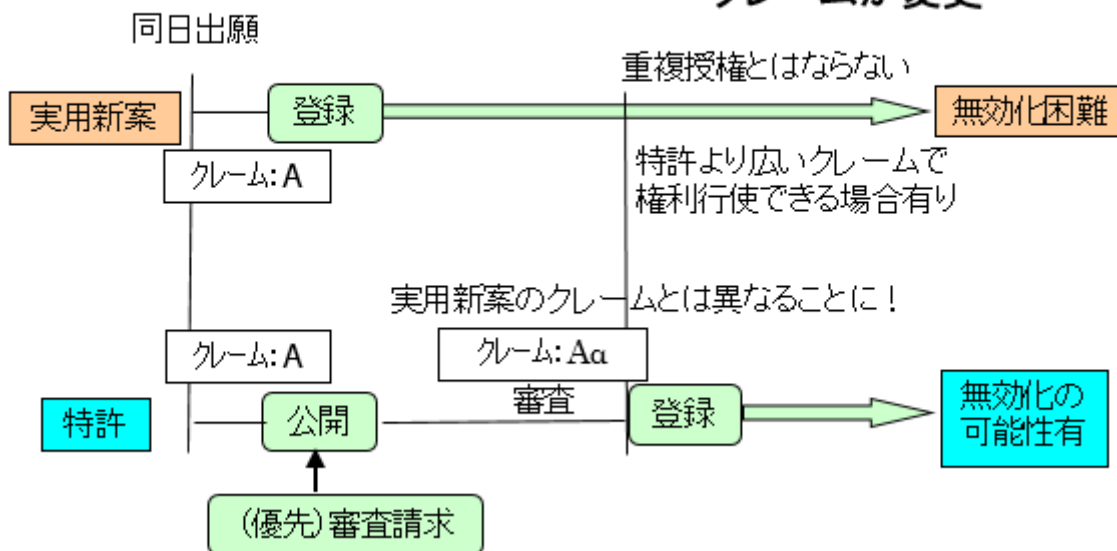


2012/8～優先審査制度施行

2つ目は、同日出願の特許審査の段階で実案の内容とは若干異なる内容に請求項を修正せざるを得ない場合があります。同一技術的範囲内ではあるが請求項が異なることとなった場合に特許が登録になっても同一発明とは見做されず、特許と実用新案の両方を維持することができます。

両方を維持するメリットとしては、実用新案の進歩性要件は特許に比べて低いため、無効化しにくく、仮に特許が無効化された場合でも実用新案によって権利維持できる、というところにあります。

審査段階で特許のクレームが変更



特許が登録になって実用新案が放棄された（重複授權放棄）例を紹介します。

名称: 结合过零保护器的单相电机无功耗起动器
申请(专利)号: CN200910183963.9
公开(公告)号: CN101636547
主分类号: H02P1/42(2006.01)I
分类号: H02P1/42(2006.01)I
申请(专利权)人: 常熟市天银机电有限公司
发明(设计)人: 赵云文

特許

申請日: 2009.08.21
公開(公告)日: 2010.01.27

同時出願の特許が登録になった

申請(专利)号: CN200910183963.9
法律状态: 授权
法律状态公告日: 2011.04.13
法律状态: 实质审查的生效
法律状态公告日: 2010.03.24
法律状态: 公开
法律状态公告日: 2010.01.27

両方は持てない。

同時出願の実案が放棄されている

申請(专利)号: CN200920234412.6
法律状态: 避免重复授权放弃专利权
法律状态公告日: 2011.04.13
法律状态: 授权
法律状态公告日: 2010.06.23

名称: 结合过零保护器的单相电机无功耗起动器
申请(专利)号: CN200920234412.6
公开(公告)号: CN2015153380
主分类号: H02P1/42(2006.01)I
分类号: H02P1/42(2006.01)I
申请(专利权)人: 常熟市天银机电有限公司
发明(设计)人: 赵云文

実案

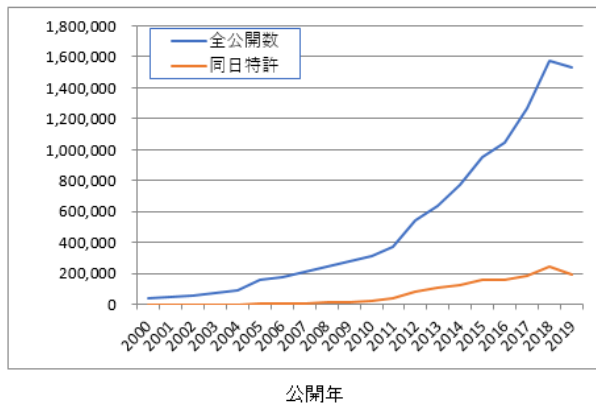
申請日: 2009.08.21
公開(公告)日: 2010.06.23
范畴分类:

また、形式的には特許出願願書と実用新案出願願書のそれぞれに、対応する実用新案または特許を出願していることをそれぞれ説明する必要がありますが、願書に用意されているチェックボックスにチェックを入れることで済むようになっています。さらに公報にもその旨が記載されることになっていますが、実用新案公報には同日出願の記載はあっても公開特許公報にはその記載は見かけないことが多いようです。

次に、このような同日出願がどのぐらいの割合で取り扱われているかをデータで見よう。データは中国版 CNIPR ですが、日本版 CNIPR との齟齬については後述。

公開年基準の収録数 (2020/7/10 現在)

公開年	全公開数	特実同日出願			同日出願率
		同日特許	実案	登録特許	
2000	38,296	39	0	0	0.1%
2001	50,364	33	0	0	0.1%
2002	58,984	48	0	0	0.1%
2003	77,472	195	0	0	0.3%
2004	93,944	940	0	0	1.0%
2005	155,446	4,509	3,518	63	2.9%
2006	172,424	6,279	5,433	665	3.6%
2007	208,345	8,198	8,577	1,538	3.9%
2008	241,182	12,948	12,853	2,983	5.4%
2009	281,006	15,966	16,596	5,264	5.7%
2010	315,836	21,136	18,110	6,296	6.7%
2011	368,434	37,743	41,570	8,179	10.2%
2012	543,296	80,981	70,878	13,952	14.9%
2013	632,585	106,077	114,150	17,059	16.8%
2014	777,335	124,730	120,268	22,957	16.0%
2015	955,341	158,273	129,234	48,892	16.6%
2016	1,045,796	156,714	137,009	29,663	15.0%
2017	1,270,655	188,316	144,032	5,519	14.8%
2018	1,575,621	245,381	224,191	154	15.6%
2019	1,532,691	192,045	214,572	43	12.5%



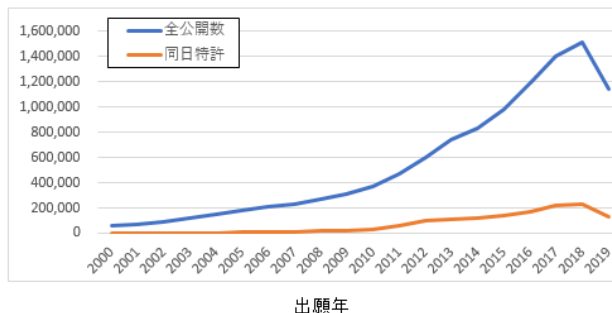
グラフでは概要はわかりますが、詳細がわからないので公開年推移として表も示しました。現時点では2019年公開分の伸びは2018年に比べて鈍くなっています。2012年以降2018年までは全公開数の約15%前後で推移していますが、2019年は12.5%とやや落ち込んでいることがわかります。

次に示す出願年推移の場合には、出願～公開までのタイムラグがあるので数年(2016年以降)のデータはデータ更新のたびに積み上がって変化しますが、公開年基準でも(全公開数は公開年基準の収録数では変化はありません)同日出願の公開特許数は、後述するようにわずかに積み上がります。

(2017年以降の同日出願数がデータ更新と共に若干増える理由は現在のところ不明)

出願年基準の収録数 (2020/7/10 現在)

出願年	全公開数	特実同日出願			同日出願率
		同日特許	実案	登録特許	
2000	56,995	79	0	0	0.1%
2001	68,214	103	1	1	0.2%
2002	89,706	146	22	23	0.2%
2003	120,451	1,054	869	586	0.9%
2004	145,276	4,272	4,059	2,351	2.9%
2005	180,464	5,723	5,500	2,820	3.2%
2006	211,777	8,449	7,944	3,996	4.0%
2007	233,556	11,318	10,885	5,066	4.8%
2008	270,269	16,123	15,840	7,258	6.0%
2009	305,980	15,181	14,428	6,994	5.0%
2010	368,598	33,847	32,827	14,124	9.2%
2011	472,082	63,849	62,401	22,793	13.5%
2012	598,055	95,909	93,950	32,710	16.0%
2013	740,876	109,979	107,295	38,260	14.8%
2014	830,782	116,119	112,462	22,164	14.0%
2015	979,133	144,114	142,414	3,646	14.7%
2016	1,187,310	169,103	170,791	260	14.2%
2017	1,398,184	216,452	218,179	158	15.5%
2018	1,509,942	228,969	231,748	17	15.2%
2019	1,140,650	130,329	131,481	13	11.4%



出願年基準ですから全公開特許数、同日出願数共にデータ更新と共に積み上がります(黄色くマークした部分)。尚、CNIPRのデータ更新は毎週火曜、金曜です。

同じ情報を日本版 CNIPR でも確認したところ次に示すマーク部分で中国版 CNIPR と齟齬が見られました。これも理由は不明です。

(法律状態情報の生死で中国版 CNIPR では「死」となっているのに、日本版 CNIPR では「生」となっている齟齬については改めて紹介したいと思います)

日本版CNIPR

公開年	全公開	特実同日出願		
		同日特許	実案	登録特許
2000	38,296	0	0	0
2001	50,364	0	0	0
2002	58,984	1	0	0
2003	77,472	108	0	0
2004	93,944	831	0	0
2005	155,446	4,379	3,518	63
2006	172,424	6,113	5,433	665
2007	208,345	7,983	8,577	1,538
2008	241,182	12,164	12,853	2,983
2009	281,006	15,604	16,596	5,264
2010	315,836	20,741	18,110	6,296
2011	368,434	37,069	41,570	8,179
2012	543,296	79,890	70,878	13,952
2013	632,585	105,025	114,150	17,059
2014	777,335	123,127	120,268	22,957
2015	955,341	156,132	129,234	48,892
2016	1,045,796	150,086	132,988	29,668
2017	1,270,655	183,470	141,257	5,517
2018	1,575,621	243,053	225,000	153
2019	1,532,691	192,045	214,572	43

公開日（発行日）基準でのデータでありながらデータ更新のたびに同日特許数（公開特許）は年単位では 2017 年以降、積み上がる状況をさらに詳しく確認するために 2018 年 6 月以降、2019 年 12 月まで 1 か月ごとに追ってみました。

発行日	2020/1/31現在			2020/5/29現在			2020/6/30現在			
	公開	同日出願	率(%)	公開	同日出願	率(%)	同日出願	公開	同日出願	率(%)
201806	142,167	19,399	13.6%	142,167	19,431	13.7%	19,392	142,167	19,445	13.7%
201807	117,717	18,295	15.5%	117,717	18,315	15.6%	18,184	117,717	18,325	15.6%
201808	123,045	24,186	19.7%	123,045	24,217	19.7%	23,794	123,045	24,225	19.7%
201809	128,839	23,985	18.6%	128,839	24,012	18.6%	23,741	128,839	24,025	18.6%
201810	113,114	17,945	15.9%	113,114	17,983	15.9%	17,760	113,114	17,987	15.9%
201811	206,608	31,270	15.1%	206,608	31,393	15.2%	31,265	206,608	31,411	15.2%
201812	179,760	22,554	12.5%	179,760	22,673	12.6%	22,673	179,760	22,687	12.6%
201901	182,239	26,470	14.5%	182,239	24,980	13.7%	24,980	182,239	24,999	13.7%
201902	105,183	16,171	15.4%	105,183	16,516	15.7%	16,516	105,183	16,553	15.7%
201903	156,103	22,481	14.4%	156,103	23,403	15.0%	23,403	156,103	23,464	15.0%
201904	150,795	15,872	10.5%	150,795	17,321	11.5%	17,321	150,795	17,399	11.5%
201905	132,720	12,650	9.5%	132,720	15,287	11.5%	15,287	132,720	15,451	11.6%
201906	120,890	9,643	8.0%	120,890	13,145	10.9%	13,145	120,890	13,371	11.1%
201907	120,922	7,628	6.3%	120,922	15,185	12.6%	15,185	120,922	15,714	13.0%
201908	118,757	3,465	2.9%	118,757	14,844	12.5%	14,844	118,757	16,241	13.7%
201909	99,417	1,803	1.8%	99,417	11,296	11.4%	11,296	99,417	13,391	13.5%
201910	101,175	650	0.6%	101,175	8,200	8.1%	8,200	101,175	10,784	10.7%
201911	128,270	235	0.2%	128,270	8,089	6.3%	8,089	128,270	13,388	10.4%
201912	116,220	94	0.1%	116,220	3,563	3.1%	3,563	116,220	8,827	7.6%

中国版CNIPR

中国版CNIPR

日本版

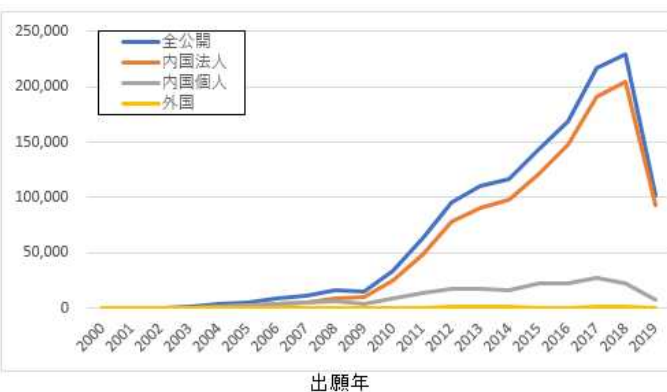
中国版CNIPR

公開日基準の2019年までの同日出願数は1年後となる2021年1月には改めて確認したいと思います。おそらく、さらに積み上がって2019年の同日出願率は約14%程度になるものと予想しています。2020年5月のデータではやはり、日本版CNIPRと齟齬ある数値となっています(マーク部分)。

このように推移している特実同日出願ですが、どのような出願人が利用しているかその属性を見てみましょう。

まず、内国の法人・個人別と外国出願人では(検証日は1か月ほど前になりますが)、

出願年	全公開	内国法人	内国個人	外国
2000	79	32	32	15
2001	103	38	44	21
2002	146	56	41	49
2003	1,054	357	400	297
2004	4,272	1,882	1,985	405
2005	5,723	2,412	2,997	314
2006	8,449	4,056	4,098	295
2007	11,318	5,951	5,141	226
2008	16,123	9,540	6,326	257
2009	15,181	10,477	4,558	146
2010	33,847	24,560	8,781	506
2011	63,849	48,529	14,353	967
2012	95,909	77,708	17,110	1,091
2013	109,979	91,198	17,432	1,349
2014	116,119	98,306	16,600	1,213
2015	144,114	121,161	22,053	900
2016	169,101	147,103	22,442	966
2017	216,403	191,237	27,005	1,185
2018	228,652	203,907	23,264	1,481
2019	102,305	93,648	7,997	660



同日出願利用者のほとんどは内国の法人出願人です。外国出願人の実用新案出願が少ないこともあり、グラフではほとんど視認できません。

次いで、少々荒っぽく、2010～2019年までの出願について2010～2014年と2015～2019年の2つの時期に分割して内外国出願人について見てみました。同日出願数のランキングで並べたため全出願が少ない出願人の同日出願率が高くなってしまいました。

データ検証は、2020/5末です。特に、2015～2019年出願についてはデータ更新で全公開数も大きく変動し、同日出願率も影響を受けるので、同日出願数そのもので見ていただいた方がいいかもしれません。

出願人名は中国表記のままとしました。

内国出願人

2010-2014出願			同日 出願率	2015-2019出願			同日 出願率
全出願	同日出願	全出願		同日出願			
华为技术	22020	4714	21%	珠海格力电器	24216	8986	37%
珠海格力电器	4077	2029	50%	美的集团	15541	3858	25%
华南理工大学	6211	1197	19%	华为技术	21210	2851	13%
东南大学	7973	989	12%	吉林大学	10474	2564	24%
吉林大学	3599	848	24%	华南理工大学	14947	2262	15%
浙江工业大学	3452	738	21%	广东美的制冷设备	6518	1874	29%
河南科技大学	2339	703	30%	浙江工业大学	10043	1470	15%
南通芯迎设计服务	821	691	84%	天津大学	14717	1331	9%
安徽江淮汽车	1011	478	47%	广东工业大学	9376	1304	14%
无锡商业技术学院	446	383	86%	广西玉柴机器	1784	1276	72%

出願年2009年以前の5年間では华为技术(HUAWEI)と中兴通讯(ZTE)が積極的に特実同日出願を活用していましたが、全出願数を落としているZTEの姿は今はありません。

外国出願人

2010-2014出願			同日 出願率	2015-2019出願			同日 出願率
全出願	同日出願	全出願		同日出願			
富士通	3336	286	9%	发那科	2947	225	8%
苹果	2105	156	7%	意法半导体	1302	175	13%
伊顿	873	133	15%	SEB	416	163	39%
三菱电机	6061	133	2%	苹果	2313	144	6%
索尼	12294	126	1%	费希尔控制	170	124	73%
吉瑞高新科技	112	112	100%	小糸制作所	541	116	21%
费希尔控制	171	106	62%	三星电机	1587	110	7%
日本电产	808	93	12%	戴森技术	258	84	33%
发那科	739	75	10%	应用材料	1532	83	5%
精工爱普生	4672	72	2%	布莱恩·阿维图姆	93	66	71%

出願年2009年以前の5年間では松下电器产业(PANASONIC)が329件の同日出願で断トツでしたが、この10年間では姿を消しています。

(参考情報)

台湾においても 2013 年から中国大陸とほぼ同様の特許・実用新案の同日出願制度が始まり、台湾特許庁のデータベース TWPAT で検索できるようになりましたので簡単に紹介しておきたい。

台湾では、当初、実用新案権取得を取得した後、同日出願した特許が成立し、実用新案権を放棄した場合、その実用新案権ははじめから存在しないものとみなすという規定だったが、2013 年 6 月の一部改正により「その実用新案権は特許の公告日から消滅する」という点で中国大陸と同じ取扱いになりました。

2020/7/10現在

出願年	全公開	同日出願	同日率
2000	171		
2001	297		
2002	6577		
2003	36009		
2004	41861		
2005	47619		
2006	49949		
2007	51513		
2008	52036		
2009	46415		
2010	47487		
2011	50197		
2012	51426		
2013	48820	335	0.7%
2014	45540	924	2.0%
2015	42779	1028	2.4%
2016	41425	1225	3.0%
2017	43423	1248	2.9%
2018	44865	1035	2.3%
2019	21385	8	0.0%

特実同日出願の歴史が浅いこともありますが、中国大陸ほど積極的に活用はされていないようです。

以上